

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 10 月 6 日 (2005.10.6)

【公表番号】特表 2001-513765(P2001-513765A)

【公表日】平成 13 年 9 月 4 日 (2001.9.4)

【出願番号】特願平 10-537248

【国際特許分類第 7 版】

C 0 7 F 5/02

C 0 7 C 221/00

C 0 7 C 225/16

C 0 8 F 2/48

C 0 8 F 4/52

C 0 9 D 7/12

C 0 9 D 201/00

【F I】

C 0 7 F 5/02 A

C 0 7 C 221/00

C 0 7 C 225/16

C 0 8 F 2/48

C 0 8 F 4/52

C 0 9 D 7/12 Z

C 0 9 D 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 2 月 10 日 (2005.2.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成17年2月10日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第537248号

2. 補正をする者

名 称 チバ スペシャルティ ケミカルズ ホールディング
インコーポレーテッド

3. 代 理 人

住 所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-22-12 SVAX TS ビル
氏 名 弁理士 (7866) 津 国 肇
電話 (3502) 7212



4. 補正対象書類名 請求の範囲

5. 補正対象項目名 請求の範囲

6. 補正の内容 別紙のとおり

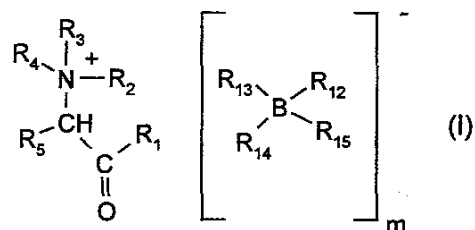


2005.2.10

(別紙)

請求の範囲

1. 下記式 (I) :

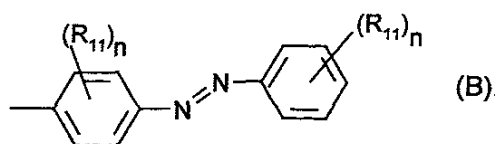
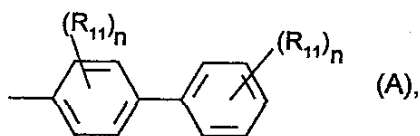


で示される化合物。

式中、

mは、1または2であって、カチオンの正電荷数に相当し；

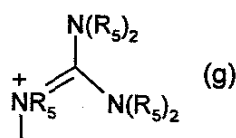
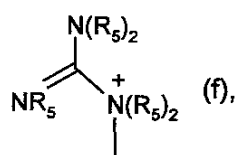
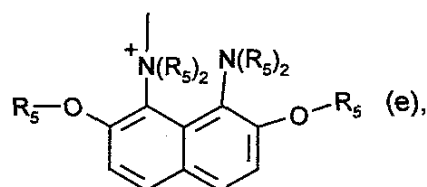
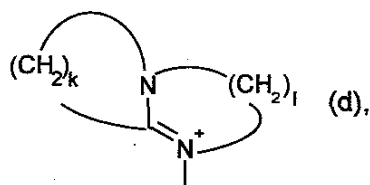
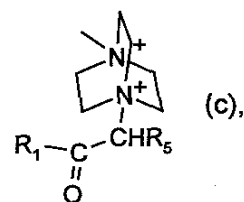
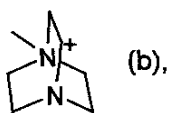
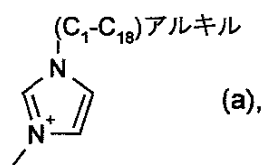
R₁ は、フェニル、ナフチル、フェナントリル、アントラシル、ピレニル、5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-2-ナフチル、5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-1-ナフチル、チエニル、ベンゾ [b] チエニル、ナフト [2, 3-b] チエニル、チアトレニル、ジベンゾフリル、クロメニル、キサントニル、チオキサニル、フェノキサチニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル、インダゾリル、プリニル、キノリジニル、イソキノリル、キノリル、フタラジニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、シンノリニル、プテリジニル、カルバゾリル、β-カルボリニル、フェナントリジニル、アクリジニル、ペリミジニル、フェナントロリニル、フェナジニル、イソチアゾリル、フェノチアジニル、イソキサゾリル、フラザニル、テルフェニリル、スチルベニル、フルオレニルまたはフェノキサジニルであって、これらの基は、非置換であるか、またはC₁~C₁₈ アルキル、C₃~C₁₈ アルケニル、C₃~C₁₈ アルキニル、C₁~C₁₈ ハロアルキル、NO₂、NR₆R₇、N₃、OH、CN、OR₈、SR₈、C(O)R₉、C(O)OR₁₀ もしくはハロゲンによりモノまたはポリ置換されているか、あるいは、R₁ は、化学式 (A) または (B) :



の基であり；

式中、

R_2 、 R_3 および R_4 は、それぞれ互いに独立に、水素、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_3 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_3 \sim C_{18}$ アルキニルもしくはフェニルであり；または R_2 と R_3 および／もしくは R_4 と R_3 が、互いに独立に $C_2 \sim C_{12}$ アルキレン架橋を形成しているか；あるいは R_2 、 R_3 、 R_4 が、結合している窒素原子とともに、 P_1 、 P_2 、 $P < t/4 >$ 型のホスファゼン塩基を、または、構造式 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) もしくは (g)：



の基を形成しており；

式中、

k および l は、それぞれ互いに独立に、2～12の数であり；

R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_9 および R_{10} は、水素または $C_1 \sim C_{18}$ アルキルであり；あるいは

R_5 および R_1 は、結合している炭素原子とともに、ベンゾシクロペンタノン

基を形成しており；

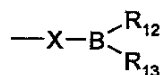
R₁₁ は、C₁～C₁₈ アルキル、C₂～C₁₈ アルケニル、C₂～C₁₈ アルキニル、C₁～C₁₈ ハロアルキル、NO₂、NR₆R₇、OH、CN、OR₈、SR₈、C(O)R₉、C(O)OR₁₀ またはハロゲンであり；そして

n は、0 または 1、2 または 3 であり；

R₁₂、R₁₃ および R₁₄ は、フェニルまたは他の芳香族炭化水素基であって、これらの基は、非置換であるか、または C₁～C₁₈ アルキル、C₃～C₁₈ アルケニル、C₃～C₁₈ アルキニル、C₁～C₁₈ ハロアルキル、NO₂、OH、CN、OR₈、SR₈、C(O)R₉、C(O)OR₁₀ もしくはハロゲンによりモノまたはポリ置換されており；

R₁₅ は、C₁～C₁₈ アルキル、フェニルまたは他の芳香族炭化水素基であって、該フェニル基または芳香族炭化水素基は、非置換であるか、または C₁～C₁₈ アルキル、C₃～C₁₈ アルケニル、C₃～C₁₈ アルキニル、C₁～C₁₈ ハロアルキル、NO₂、OH、CN、OR₈、SR₈、C(O)R₉、C(O)OR₁₀ もしくはハロゲンによってモノまたはポリ置換されており、あるいは

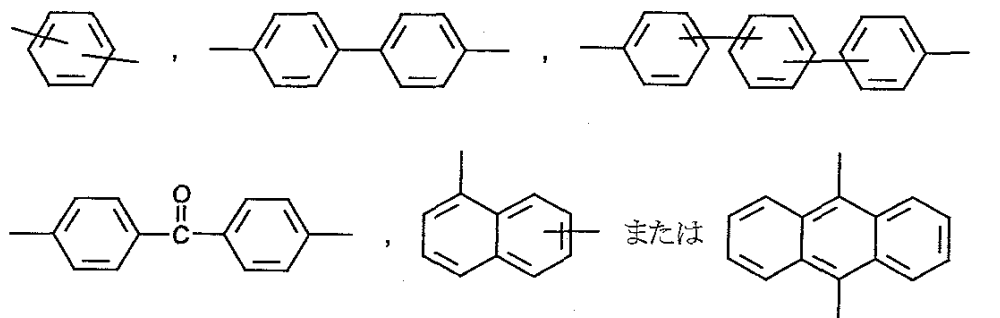
R₁₅ は、式：



に示す基であり；そして

式中、

X は、C₁～C₂₀ アルキレン、-O-、-S- もしくは NR₈ によって中断されている C₂～C₂₀ アルキレンであるか、または X は式：

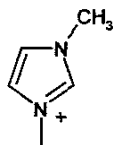


に示すものであって、

R₁₂、R₁₃、R₁₄ および R₁₅ が同時にフェニルである場合には、

(a) R₂、R₃ および R₄ が同時にはメチルでないこと；および

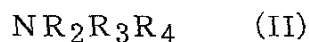
(b) R₂、R₃ および R₄ はともに式：



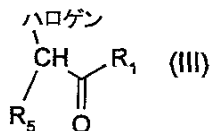
に示す基でないこと；

の条件に合致する化合物。

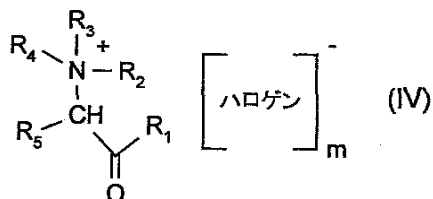
2. 化学式 I の化合物を製造する方法であって、第 1 段階として、式 (II)：



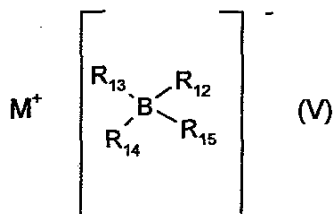
の窒素性塩基を、式 (III)：



の α -ハロゲンケトンと反応させて、式 (IV)：



の化合物とし、そして、第 2 段階で、式 (IV) の化合物を、式 (V)：



の化合物と反応させて、式 (I) の化合物にすることを含み、

式中、

ハロゲンはブロモまたはヨードであり、MはNa、Kまたはアンモニウムであ

り、そしてR₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₁₂、R₁₃、R₁₄ およびR₁₅ は、請求項1に記載の意味と好ましい意味とを有する方法。

3. 組成物であって、

A) 式 (I) の化合物の少なくとも1種、および

B) 塩基触媒による付加反応または置換反応が可能な有機化合物の少なくとも1種を含む組成物。

4. 成分A) が、成分B) を基準にして、0.01～10重量%の量で存在する、請求項3に記載の組成物。

5. チオキサントン類、オキサジン類、アクリジン類、フェナジン類およびローダミン類からなる群より選ばれた増感剤を追加的に含む、請求項3に記載の組成物。

6. 請求項3に記載の組成物を、波長200～650nmの光に露光することを含む、塩基触媒反応を実施する方法。

7. 請求項3に記載の組成物を用いて、少なくとも1個の表面を被覆された被塗装基材。

8. 請求項3に記載の組成物の、重合または架橋した生成物。